# 先端加速器試験装置(ATF)における R&D の現状

照沼 信浩<sup>\*1</sup>·内藤 孝<sup>\*2</sup>·奥木 敏行<sup>\*2</sup>·久保 浄<sup>\*2</sup>· 黒田 茂<sup>\*2</sup>·荒木 栄<sup>\*2</sup>·田内 利明<sup>\*2</sup>·浦川 順治<sup>\*2</sup>

#### Recent Status of the Research and Development at the ATF

Nobuhiro TERUNUMA<sup>\*1</sup>, Takashi NAITO<sup>\*2</sup>, Toshiyuki OKUGI<sup>\*2</sup>, Kiyoshi KUBO<sup>\*2</sup>, Shigeru KURODA<sup>\*2</sup>, Sakae ARAKI<sup>\*2</sup>, Toshiaki TAUCHI<sup>\*2</sup>, and Junji URAKAWA<sup>\*2</sup>

#### Abstract

Accelerator Test Facility (ATF) of KEK is a research center for studies on issues concerning the injector, damping ring, and beam delivery system for the ILC. The ATF damping ring reduces the vertical emittance of the beam down to 4 pmÅrad. ATF2 is a final-focus test beam line that aims to focus the low emittance beam from the damping ring to a vertical size of about 37 nm and to demonstrate the nanometer level beam stability, using numerous advanced beam diagnostics and feedback tools. These tools have been developed through R&D at the ATF, and applied for the newly constructed ATF2 beam line. Further improvements will be continued in parallel to the commissioning of the nanometer beam focus. A large number of scientists from SLAC, LBNL, FNAL, Oxford University, DESY, CERN, UCL, LLNL, IHEP, PAL, RHUL and Japanese universities participated in research programs at the ATF/ATF2.

# 1. はじめに

KEK における ATF<sup>11</sup> (先端加速器試験装置) では, 国際リニアコライダー (ILC) 計画<sup>22</sup> など将来の加速 器で必要とされるビーム計測技術およびビーム制御技 術の開発を行っている.現在の ATF はマルチバンチ ビーム生成を行う photocathode RF gun, 1.3 GeV S-band Linac,低エミッタンスビームに変換するダン ピングリング,そのビームを利用し ILC 最終収束シス テムの開発試験を行う ATF2 ビームラインは 2009 年よ り運転を開始している<sup>40</sup>.

ATF は 1996 年のダンピングリング稼働以来,4 pm の垂直エミッタンスの達成を初め,様々なビーム計測 機器や制御機器<sup>5,6)</sup>を開発してきた.現在,ATF にお ける主要な開発目標は ILC 設計の進展に伴い次のよう にまとめられる.

- 1.2 pm の低エミッタンスの実現
- 2. ナノ秒高速キッカーの開発・実証試験
- 3. 垂直方向 37 nm の極小ビームの実現
- 4. ナノメートルレベルのビーム位置安定化

前半はダンピングリングとその取り出し系の開発研 究であり,後半は ATF2 ビームラインにおける開発研 究である.これら主要テーマと同時に関連する周辺技 術開発も行っている.

ATF はこのように多岐に渡る先端的研究開発を行う 非常に魅力的な加速器施設であり、国内外の大学およ び研究機関から多くの研究者が開発研究に参加してい る. この国際的な研究活動を支えるため、MoU (Memorandum of Understanding) に基づくInternational Collaboration<sup>7)</sup>が立ち上げられている.現在まで に25の研究機関が MoU に署名しており、この体制の 下、海外から訪れる共同研究者は年間で延べ2000人・ 日を超える.大学院生も多く参加しており、若手研究 者の育成に国際的にも大きく貢献している.海外から は人材貢献に加えて、測定装置やビームライン構成機 器などの物的貢献(In-kind contribution)も行われて いる.例えば、ATF2 ビームライン建設のために、多 くの電磁石、Cavity BPM、電磁石電源などが持ち込ま れている.

ATF 加速器の運転は年間で21週間である. 夏期と 年末年始の停止を除き,2~3週間のビーム運転後に1

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup> 高エネルギー加速器研究機構 KEK, High Energy Accelerator Research Organization (E-mail: nobuhiro.terunuma@kek.jp)

<sup>\*2</sup> 高エネルギー加速器研究機構 KEK, High Energy Accelerator Research Organization

#### 先端加速器試験装置(ATF)における R&D の現状







図2 ATF ダンピングリング

週間の保守期間を設け、それを繰り返す. 先端加速器 技術開発を目的としている ATF にとって、この保守期 間は故障機器の修理のみならず、ビームライン上の研 究装置の準備・改善・問題調査などに使われており、 効率良く研究を進める上で必須のものとなっている. ビーム運転時間のおおよその配分は、ATF2 開発研究 に 50%、電子銃からダンピングリングまでの開発研究 に 30%、その他の加速器調整に 20%、としている.

# 2. ビーム生成・制御技術開発

## 2.1 ATF の電子ビーム構造

ATF の電子ビームはパルスあたり 1 ~ 20 個のバン チで構成されるマルチバンチ(このパルスあたりのバ ンチ列をトレインと呼ぶ)であり,高量子効率の Cs<sub>2</sub>Te フォトカソードを用いた S-band 高周波電子銃に より生成される<sup>8)</sup>.電子ビームはカソードに照射する レーザー光のバンチ構造と強度に従って生成される. ATF では二つの繰り返しの異なるレーザーが設置され



図3 ATF2, 最終収束システム試験ビームライン

ており, それぞれ 2.8 ns 間隔 1 ~ 20 バンチ, または 5.6 ns 間隔 1 ~ 10 バンチの電子ビーム生成に使われている. どちらの場合でも開発研究に必要な十分な強度の電子ビームを生成できる.通常の運転ではバンチあたりの電子数 1 × 10<sup>10</sup> 個のマルチバンチビームを 1.56 Hz の繰り返しで生成している.

生成された電子ビームはリニアックで 1.3 GeV まで 加速され、ダンピングリングに入射後に低エミッタン スビームとなり、ATF2 ビームラインへと取り出され る. この際、リングでは最大3トレインまで蓄積する ことが出来る. リングから取り出される電子ビームの 構造は、(1)電子銃で生成されたものと同じバンチ列 構造(2)154 ns 間隔での連続3バンチの二つのモード がある. これらは立ち上がり 60 ns で flat-top 約 300 ns の通常型のパルスキッカー電磁石を使用して実現され る. このキッカーシステムは安定度を改善するために ダブルキッカー構成<sup>9)</sup>(1台の電源で Phase Advance が π 離れた位置の2台のキッカー電磁石を駆動する) となっている. 最近ではこれらに加えて、ナノ秒高速

-173 -

キッカーによる(3) 308 ns 間隔での連続 30 バンチの 取り出し,を実用化に向けて試験している.

## 2.2 ナノ秒高速キッカー (Fast Kicker)

ナノ秒で高速に立ち上がるビームキッカーは,ILC ダンピングリング (DR) に必須の技術である.ILC で は例えば 308 ns 間隔で 2820 個のバンチがトレインを 構成し,その長さは約 260 km にも及ぶ.その為,リ ング内にバンチ間隔を圧縮した状態で蓄積して,リン グ周長を抑える必要がある.他の周回しているバンチ に影響なく目的のバンチの入射・取り出しを行うため にナノ秒の立ち上がり・立ち下がりを有するキッカー が必要となる.例えば,繰返し3 MHz,キックパルス の立ち上がり 6 ns 以下となる.

KEK では、複数のストリップライン電極に半導体 パルサーの高速パルスを印加することによって高速・ 高繰り返しのビーム蹴り出しを実現する方式を提案・ 開発を行ってきた.既に、ストリップラインを用いた ビームでの基礎試験では 2.2 ns / 2.4 ns の立ち上がり / 立ち下がり時間を実現している<sup>100</sup>(図4).この結果 を踏まえて、現在の ILC 計画ではこの KEK 方式のキッ カーを採用することを前提に設計が進められており、 DR の周長は 6.7 km になっている.

ATF では上記の基礎試験をさらに進めて,実際に ビームをリングから取り出すシステムの開発を進めて いる. ILC-DR での入出射キッカーシステム開発のた めの実証・評価,さらに ATF2 実験における連続バン チビームの利用を狙う.

ATF-DR からのビーム取り出しでは、既存のパルス

電磁石キッカーと同じ4.6 mradのキック量が必要であ るが、与えられるスペース内で実現できるストリップ ラインのキック量は最大1.5 mradである.そのため図 5の様な補助システムを開発した.ビーム取り出しに 合わせて DR 内に local bumpを作り、さらに下流に薄 いセプタム導体(1.6 mm)の補助(Auxiliary)Septum magnetを設置して不足分を補う.ストリップライン は電極長 60 cmのものが2組(電極間9 mmと11 mm)設置されている.それぞれ左右の電極に正負の パルス電圧をかける.このパルス電源には FID 社の FPG10-3000KN(10 kV,4 nsパルス幅)が合計4台使 用されている.この電源とストリップライン電極の組 み合わせで実現されるビームに対する Kick Fieldの立 ち上がりは、5 ns以下であり、蹴り出すバンチの直前



図4 ナノ秒高速キッカーの立ち上がり試験:ダンピングリング周回ビームを蹴り,振動振幅よりキック量を評価した



図5 ナノ秒高速キッカーによるビーム取り出し軌道



図6 ナノ秒高速キッカーにより DR から取り出されたマル チバンチビーム (308 ns 間隔)



図7 ATF における Intra-train 高速フィードバック構成

(5.6 ns 間隔)を周回しているバンチには影響しない.

ATF2 でのマルチバンチ利用では,現在の3バンチ より多くのバンチを連続で取り出すことを想定してい る.図6に示す様に,5.6 ns 間隔 10 バンチ,3 トレイン, 合計 30 バンチのビームを ATF-DR 内に蓄積する.こ れらをストリップラインキッカーを用いて,各トレイ ンの最終バンチから順に取り出し(308 ns 間隔),ト レインを一巡したところで 5.6 ns タイミングをシフト させ繰り返す.結果,ほぼ揃った間隔で連続 30 バン チのビームを取り出せることになる.

この高速キッカーによるビーム取り出しは, 昨年10 月に成功した. 幾つかの改良を経て, 本年6月に再試 験を行い, 連続した30バンチ(308 ns間隔)の取り 出しを観測し, システムが期待通りに動作しているこ とを確認した. ただ残念なことに, この試験中におい



図8 Intra-train 高速フィードバック (FONT) によるバンチ 位置補正

て、ダンピングリングでのマルチバンチ蓄積が不安定 であった.その為、取り出されたビーム強度が弱く、 またバンチごとの強度も一定していない.今後、この 原因の解明と対策を講じ、ビーム強度が安定した状態 での運用試験を進める.

取り出されたビームの軌道解析から、本システムの 安定度が評価されている.測定はシングルバンチで行 い、各 shot ごとに Kick 角を評価した.ビーム位置の 測定には ATF2 ライン上の高分解能 Cavity BPM を用 いている.得られた安定度は 3.5 × 10<sup>-4</sup> であった. これは現ダブルキッカーシステム(パルス電磁石)に よるものと同程度の良い安定度である<sup>11)</sup>.

#### 2.3 Intra-train 高速フィードバック開発

ILC 衝突点でのナノメートルサイズの電子と陽電子 の衝突を維持するために,相対的なバンチ位置を補正 する高速フィードバック技術が重要である.また,ビー ムラインにおける振動の影響を補正し,仮想衝突点 (ATF2-IP)においてナノメートルレベルでビーム位置 を安定化させることは,ATF2の重要な技術開発目標で ある.図7にATFで試験中のシステム構成を示す<sup>12)</sup>. 連続したマルチバンチビームにおいて,先頭バンチの 位置を検出し,後続するバンチ位置を140 ns 以下の高 速で補正することを目指している.試験装置はATF2 上流の取り出しライン部に設置されており,ATF2 最 終収束ビームラインに入射する前のバンチを補正す る.現在は通常のパルスキッカー電磁石で取り出され る 154 ns 間隔の連続 3 バンチで試験している.

先頭バンチ位置を検出して後続バンチを補正(蹴る) するまでに要する時間は133 ns を実現している. 図8 に最新の結果を示す.フィードバック無しでは3バン チ共に2μmのジッターであるが,フィードバックを かけることで第2と第3バンチのジッターが0.4,0.8 μmに改善されている.仮にこのフィードバックの状 態でビームが仮想衝突点まで(理想的に)他のエラー 無く転送されるとした場合,衝突点でのジッターは15 nmから3nmに軽減されると期待される.実際は, ATF2ビームラインでの床振動などの影響を受けると 考えられる.そのため,仮想衝突点でのナノメートル レベルの位置安定化技術開発では,(1)リングから取 り出したビームを,現システムを用いてATF2入射前 に補正,(2)仮想衝突点では高分解能 IP-BPM を用い て本フィードバックを形成し,ATF2ビームライン上 の床振動などの影響を補正する,ことを検討している. 加えて,前述の高速キッカーで取り出される連続した 30バンチのビームを用いた安定化試験を行う計画であ る.

# 3. ビーム診断装置開発

## 3.1 高分解能ビーム位置モニター

ATF ではナノメートル位置分解能を実現する空洞型 ビーム位置モニター(Cavity BPM)開発を行い、ビー ムによる試験で分解能 17 nm を確認した<sup>13)</sup>. この高分 解能 BPM は、ATF2 ビームラインの主たる BPM とし て合計 38 台が導入されている (図 9). このシステム の実践的運用もATFにおけるR&Dの一部と言える. 実際,ATF2 ビームラインの調整と平行して整備・改 善を行ってきた.要求された分解能は ILC でのシステ ム運用を想定して 100 nm とした. いくつかの BPM ユ ニットでは信号伝送系の改善が必要であるが、現在ま でに 20 nm の位置分解能をビームで確認している. 一 方でこれらとは別に、仮想衝突点での位置変動測定や フィードバックを行うために、2 nm 分解能を目指す Cavity BPM (IP-BPM) の開発が進められている. 試 作システムのビーム試験では、8.7 nm の分解能を実現 している<sup>14)</sup>.現在は読み出し回路開発に重点を置き, ATF2 ビームライン上で試験を継続している.

一方,ダンピングリングの BPM システムでは,読 み出し回路系の高性能化<sup>15)</sup>が本年6月に行われている. これは,ILC-DR で想定されている 2 pm エミッタンス を実現するために,高精度の位置情報によるビーム調 整が必要なためである.従来の One path/one shot 測 定に加えて高分解能 Narrow band mode での測定, turn by turn での位置測定が可能となり,高精度で多 彩なビーム軌道調整が期待される.

## 3.2 ビームサイズモニター

ダンピングリングの低エミッタンスビーム調整で は、ATF で開発されてきたビームサイズモニターが活 躍している.シンクロトロン放射光(SR)干渉モニター (SRIF)<sup>16)</sup> とX線領域のSR モニター (XSR)<sup>17)</sup>は相補 的にリアルタイムのビーム調整に使われている.レー ザー蓄積 Cavity を利用したレーザーワイヤー (LW)<sup>18)</sup> は一回の測定に数分かかるが、電子ビームをレーザー で直接スキャンするため、最終的なエミッタンス評価 に用いられている.

リングから取り出されたビームのエミッタンス測定 はワイヤースキャナー(それぞれ直径 10 μm と 7μm のタングステンとカーボンワイヤー使用)<sup>19)</sup>で行って おり,測定には多数のビームパルスが必要で数分か かっている.これをパルスごとにリアルタイムに測定 できるように Optical Transition Radiation(OTR)を利 用した二次元プロファイルモニター<sup>20)</sup>の開発が始め られている.また,非破壊型ビームサイズモニターで、 ILC 仕様である 1μm 分解能を目指すレーザーワイ ヤー<sup>21)</sup>の開発も行われている.現在までのビーム試 験で分解能 2.2μm を達成している(**図 10**).

ATF2 の目標の一つである垂直方向 37 nm の極小 ビームの測定は、レーザー干渉縞を利用したモニター (IP-BSM,通称新竹モニター)で実現される<sup>22)</sup>.この モニターは、SLAC での FFTB 実験で開発・実証され たもので、ATF2 では幾つかの改造を加えている<sup>23)</sup>.



図9 ATF24極電磁石に取り付けられた Cavity BPM (C-band)



☑ 10 Pulsed laser wire at ATF2

図 11, 12 にシステム構成概念を示す. 仮想衝突点にお けるビームサイズは、レーザー干渉縞と電子ビームの 相対位置を変えることで得られる逆コンプトン散乱信 号の変調(modulation)から求めることができる. レー ザーの波長はATF2のビームで測定感度が高くなるよ うに FFTB の半分 532 nm に変更された. また, FFTB では干渉縞は固定でビームを動かして profile scan し ていたが、ATF2 では干渉縞を動かして scan 出来るよ うになっている. 干渉縞のピッチで測定できるビーム サイズの範囲が制限されており、ビーム調整状況に応 じてレーザーの交差角を変える必要がある. レーザー 交差角は FFTB での 174°, 30° に加えて,新たに 8° から 2°の可変モードが追加された.これにより垂直方向の ビームサイズ測定が 20 nm から 5 µm の広範囲で可能 となり、今までのワイヤースキャナーの測定限界 (3µm) までカバーすることができる. γ線検出器は 多層の CsI (Tl) からなり、コンプトンγ線とバック グラウンドによるものとのシャワーの拡がり方の違い を利用して、バックグラウンドからの寄与を低減する 解析方法も導入されている.

このモニターの立ち上げは 2009 年からレーザーワ イヤーモード(レーザービームの一方を用いたもの) で開始された<sup>24)</sup>. ビームラインの調整が始まったばか



図11 ATF2 レーザー干渉縞型ビームサイズモニター配置

りでビームサイズも 5µm 以上であったためである. ビーム調整の進展と共に干渉縞モードの試験・調整が 行われ,夏期休止明けの 2009 年 11 月に干渉縞モード による最初の垂直方向ビームサイズを測定した.この ときのレーザー交差角は 3°,ビームサイズは 3.3µm であった.現在は ATF2 ビームラインの調整が進み, 交差角 30°での測定が可能なレベルにある.なお,測 定された最小ビームサイズは交差角 8°において 310 nm である. 今後さらにビーム調整が進み 100 nm を切 る状態になれば,最終測定レンジである交差角 174°で の測定に移る.

# 4. 低エミッタンスビームの状況

## 4.1 低エミッタンスビーム調整方法

低エミッタンスビームを得るには,垂直 Dispersion と 水平方向と垂直方向の運動の Coupling (x-y Coupling) を極めて小さくしなければならない.通常の低エミッ タンスビーム調整では、以下の3つの補正を続けて行 う<sup>25)</sup>.

1)閉軌道の補正: BPM の読みが小さくなるように
軌道補正用2極電磁石を設定する.

2) 垂直方向の Dispersion と閉軌道の補正:垂直方向の Dispersion (リングの RF 周波数を変化させたときの軌道の変化)を小さくするように補正用 2 極電磁石を設定するが, BPM の読み自体も小さくなるようにする.

3) x-y Coupling の補正:2つの水平方向補正用2極 電磁石を選び,これらの変化に対する垂直方向の軌道 の変化が小さくなるように,Skew 4極磁場(6極電磁 石の各磁極の補正コイルがSkew 4極磁場を発生する ように配線されている)を設定する.

ATF では,2004 年までに 4 pm 程度の低エミッタン スを確認することができた<sup>26,27)</sup>.その後しばらくの間,



図12 ATF2 レーザー干渉縞型ビームサイズモニター. 100 nm 以下の測定で使用するレーザー交差角 174°のモードを例示している

低エミッタンス生成を追及することが主要な目的でな くなっていたため,通常の補正だけではこの低エミッ タンスを実現できない状態が続いていた.多少エミッ タンスが大きくても進行中の開発研究には支障が無 かったため,敢えてビーム時間を費やすことをしてい なかったのである.しかしながら,2008年頃から最終 収束システム (ATF2) や Fast Ion 不安定性の研究な どのため,再び低エミッタンスビームが要求されるよ うになった.以下,低エミッタンスビームを再現する までに行った様々な方法を記述する<sup>28)</sup>.

# 4.2 BBA (Beam based alignment)

BPM のゼロ点とその近くの磁石(4極,又は6極) の磁場中心とのずれが,エミッタンス調整の結果に大 きく影響する.このため,ビームを使った BPM と磁 場中心とのずれの測定を行っている.この測定は,各 BPM とそれに最も近い4極電磁石(又は6極電磁石) について,一組ずつ行う.まず,垂直方向のエミッタ ンスにより影響する垂直方向のずれを集中して測定し た.

BPM-4 極電磁石の組については,垂直方向にいくつ かの高さの閉じたバンプ軌道を立て,各バンプに対し て磁石の強さを変化させたときの全リングに渡っての 垂直方向の軌道変化を測定する(バンプの設定は,ビー ム位置変化が対象となる BPM と磁石の場所で同じに なるようにしておく).ビームが磁場の中心を通って いれば軌道の変化はないはずで,このデータから磁場 中心と BPM の読みの関係がわかる.

BPM-6 極電磁石についても方法は同様である.ただし、4 極磁場の変化の代わりに Skew 4 極磁場(補正 コイル)を変化させ、水平方向の軌道変化を測定する ことにより、垂直方向のずれを測定する.

2009年4月には、曲線部分にある主4極電磁石と全 ての6極電磁石についてBBAの測定が行われ、ずれ の測定値の代表的な誤差(BPMの誤差から計算され る)は、4極電磁石について30µm、6極電磁石につ いて80µmであった.この誤差は2pm程度の低エミッ タンスを実現するためには十分小さい.

## 4.3 ベータ関数のビートの補正

2008 年夏頃の optics の設定には、ベータ関数の大き なビートがあることがわかり、これが低エミッタンス 調整を妨げていたと考えられる.このため、2008 年秋 には磁石の強さを設計値に設定し、ビームを使った測 定に基づいて補正を最初からやり直すこととした.

設計値と思われる値に設定しても種々の誤差のため にベータ関数のビートが生じる.まず,この誤差を全 ての4極電磁石での測定値を入力データとして用いた 計算により補正することを試みた.しかし,補正の前後でのベータ関数の変化は計算で予測されるものと大きく食い違い,計算に用いた optics のモデルがあまりよくないことを示した.この点に関してはさらに詳細な研究が必要と思われる.

しかし,曲線部の1種類の4極電磁石(垂直方向の ベータ関数が大きい.QF1Rと呼ばれる)での垂直方 向ベータ関数のみに注目し,ここでのベータ関数の ビートを部分的に補正できる少数の4極電磁石の磁場 を変更することにより,ベータ関数のビートをある程 度小さくすることができた.ビートの補正は完全では ないが,目標とする2pm 程度の低エミッタンスを実 現するためには十分小さいと考えられる.

# 4.4 Orbit Response Matrix (ORM) データの 解析

Orbit Response Matrix (ORM) の解析は optics error の原因の同定と補正に役立つ確立された方法である<sup>29)</sup>. これは,簡単に言えば,多くの軌道補正用磁石の強さ の変化に対する閉軌道の変化を一つずつ測定し,4極 電磁石の強さ,BPM の補正係数や x-y Coupling,補正 磁石の強さや回転エラーなどのパラメータを調整する ことで,測定データとモデルを合わせることである.

ATFでは、全ての軌道補正用磁石と全ての BPM を 使って ORM が測定されている。一つの解析では、こ のデータが 34 個の Skew 4 極磁場(6 極電磁石の補正 コイルに対応)を含むパラメータで fitting された。こ れは、x-y Coupling の原因を Skew 4 極にすべて押し 付けることを意味し、この結果を使って Coupling を補 正するための Skew 4 極磁場の設定を計算することが できるはずである。ATF での以前の研究<sup>30)</sup>で、この 方法の正しさが確かめられているが、今回も x-y Coupling を補正する試みで、同様の結果が得られてい る。この方法が通常の x-y Coupling の補正(軌道補正 用磁石 2 つだけに対する軌道変化のデータを使う)と 比べて明らかに優れているという実験的なデータはま だ得られていないが、解析と補正方法をさらに検討す ることでよりよい結果が得られる可能性がある。

#### 4.5 低エミッタンスビーム調整の現状

様々な方法を使った努力により、ビーム調整直後の ダンピングリングの垂直エミッタンスを、ほぼ確実に 10 pm 以下にすることができるようになった. 図13 に 最近の垂直方向エミッタンス測定の結果を示す.

より小さな垂直エミッタンスビームを得るために は、補正方法に関するより詳細な研究と、測定データ の解析が必要と考えられる.さらに、ここでは説明し なかったが、BPM 読み出し回路の改良によるビーム



図 14 ATF2 のビーム光学系. 2010 年 5 月までは High Beta Optics でビームラインを調整

位置測定精度の向上,磁石のアラインメントの再調整 なども行われている.

# 5. 最終収束システム(ATF2)の状況

ATF2 最終収束ビームラインの運転は 2009 年 2 月よ り本格的に開始された、しかしながら、ATF には最終 収束システム以外の開発プログラムも多数有りビーム 時間を割り当てる必要があること、ATF2 に導入した 高精度のビーム診断装置の立ち上げや各種ビーム制御 ソフトウェアーの開発に比較的多くの時間が必要で あったことなど、2009年度中においては、ナノメート ルビーム調整のために数日を超えるような連続した時 間を割り与えるまでには至らなかった.その後、レー ザー干渉縞ビームサイズモニターが運用レベルに立ち 上がったことを受けて、連続した調整運転の気運が高 まり、2010年5月に、最初のATF2ビーム調整に特化 した連続1週間の試験的運転を行った. この際に用い たビーム光学系は High Beta Optics と呼ばれるもので あり、本来の設計光学系に対し水平・垂直方向のベー タ関数を共に10倍大きくして IP-BSM 測定器へのバッ クグラウンドの軽減などを考慮したものである(表1, **図 14**).

## 5.1 最終収束ビームラインまでの調整

まず,連続調整運転の最初にダンピングリングの調 整をおこなった.調整の結果,垂直方向エミッタンス を10 pm 前後まで絞った.また,円形加速器では水平 方向エミッタンスはビーム光学系の設定で決まる.そ して,ATF ダンピングリングでは常に1.5~2.0 nm の範囲である.連続調整運転でダンピングリング内で の水平方向エミッタンスの測定は行わなかったが,1.5 ~2.0 nm であると考えてよい.

取り出しセクションは、ダンピングリングから取り 出されたビームの Dispersion を補正して、下流の ATF2 最終収束ビームラインに送るためのビームライ ンである.取り出しセクション出口では、水平方向、 垂直方向とも Dispersion は無くなるように設計してあ る.しかし、ダンピングリングからの Dispersion の漏 れ、4 極電磁石の強さの設計値からの違い、軌道補正 用コレクターの磁場などの影響で、実際には取り出し セクションの出口で Dispersion が出来てしまう.この 出口の Dispersion を補正するために、取り出しセク ション上流の Dispersion がある領域(最初の偏向電磁 石で作られている)において、電磁石の強さを調整す る.水平方向の補正には4 極電磁石を使い、垂直方向 の補正には Skew 4 極電磁石を使う.しかし,Skew 4 極電磁石の強さを変えると,Dispersion だけでなく, Coupling も同時に生成してしまう.これを防ぐため, ATF2 では位相進度が π 離れ,かつ,同じベータ関数 となる位置に置いた 2 台の Skew 4 極電磁石を,同時 に同じ強さだけ変えて,生成される Coupling を小さく 抑えている (sum-knob)<sup>31)</sup>.図15 に,sum-knobを使っ たときのビームラインに沿ったエミッタンスの変化を 示す.1台目の Skew 4 極電磁石を通過したとき Coupling でエミッタンスが増大する.しかし,2台目 の Skew 4 極電磁石を通過した時には,2つの Skew 4 極電磁石の Coupling の効果が打ち消し合い,エミッタ ンス増大を小さく抑えることが出来ていることがわか る.

ATF2 ビームラインには、水平方向の Dispersion 補 正のために QF1X と QF6X という 2 個の調整 knob が ある.一方、垂直方向の補正には一つの sum-knob し か調整 knob が無い.しかし、取り出し領域の電磁石 はほぼ全ての位相進度が $\pi$ の整数倍になるように置か れているので、取り出し領域で生成される垂直方向 Dispersion もほぼ同位相になる.それ故、ATF2 では 同位相の 1 つの調整 knob を使うことで Dispersion の 補正をすることが可能である.

連続運転においても、取り出しラインにおいて、 Dispersion 補正をおこなった. 補正後の最終収東ビー ムラインでのDispersionを図16に示す. 丸が測定値で、 実線が測定値からのフィットで求めた Dispersion を示 している. 水平方向 Dispersion は、設計通り直線部で は補正されており、仮想衝突点付近で再びゼロとなっ ていることが分かる. また、垂直方向に関しても、最 終収東ビームライン全ての場所で10 mm 以内に収まっ ている.

マッチングセクションは、取り出しセクションと、 最終収束ビームラインのビーム光学系との間のマッチ ングをとるためのビームラインである. 最終収束点に おける電子ビームの収束率の調整や、Coupling、Twiss Parameter の補正はここで行う. マッチングセクショ ンには、最終収束ビームラインに入る前に、Coupling を補正する為の4台の Skew 4極電磁石と、エミッタ ンス測定の為の5台の Wire Scanner が置かれている. 下流の Wire Scanner で測定される垂直方向のビーム サイズが最小になるように Skew 4極電磁石の強さを 設定することで、Coupling 補正を行なう.

連続運転においても、マッチングセクションでエ



図15 ATF2 での Dispersion 補正. sum-knob を使ったとき のエミッタンス変化の例



図16 連続運転での Dispersion 補正結果



図17 連続運転でのエミッタンス測定の結果

ミッタンス, Twiss Parameter の測定をおこなった. その測定結果を図17に示す.連続運転では, Coupling の補正を行わなくても,エミッタンスは水平方向が 1.88 nm, 垂直方向が13 pm とダンピングリングで測 定された値に近い値を示した.そのため,今回は Coupling の補正を行わず,この測定された Twiss Parameter を基に,仮想衝突点でのマッチングをとっ た.

#### 5.2 仮想衝突点におけるビームサイズ調整

ATF2 の最終収束ビームライン(図18)には5台の 6極電磁石があり、ChromaticityやGeometrical Aberrationの補正に使われる.また、これらの電磁石 には位置調整用 mover が取り付けられており、仮想衝 突点におけるビームウエストの位置、Dispersion、 Couplingの精密調整に使われている.これらの調整 Knobのことを Multi-knob と呼んでいる.連続運転で 使用した Multi-knob のパラメーターを表2に示す.

仮想衝突点には Wire Scanner とレーザー干渉縞型 ビームサイズモニター (IP-BSM) が設置されており, 前者は  $3\mu$ m 以上,後者は  $5\mu$ m ~ 20 nm のビームサイ ズ測定に使われる.また,ここでの Wire Scanner は, 水平方向の Dispersion,水平・垂直方向のビームウエ スト, Coupling の補正を行う場合にも使われている.

ビームサイズ調整は以下のように行われる.最初に, 仮想衝突点の水平方向の Dispersion 補正を行う.連続 運転の例では,最終収束電磁石 QF1FF の強さを 0.7% 下げた際に水平方向 Dispersion を消すことができた. 続いて垂直方向のビームウエストの補正を行う.この



図18 ATF2の最終収束ビームラインのビーム光学系と配置.最下流にあるQF1FF,QD0FFと記された2つの4極電磁石が最終収束電磁石であり、図中には5個の6極電磁石が置かれている位置も示してある例

補正では最終収束電磁石 QDOFF を調整する. QDOFF は水平方向 Dispersion の依存性が少なく, それを変え ることなく, ビームウエストの位置をずらすことがで きる. このように, 水平方向 Dispersion, 垂直方向のビー ムウエスト位置を最適化した後, 水平方向のビームウ エスト位置を補正する. ここでは Irwin Knob<sup>32)</sup> を使っ てマッチングセクションの4極電磁石の強さを変える. ここまでの段階で, 垂直方向のビームサイズは2から 3µm 程度を示していた.

続いて、最終収束電磁石のビーム軸回りの回転 (Roll) を調整して Coupling の補正を行った. QF1FF の Roll とビームサイズとの依存性が非常に強く、4~5 mrad 回転させたところで Wire Scanner のワイヤーが切れ てしまった. ビームが小さくなり Tungsten wire が切 れたと考えられる. ここから、IP-BSM のみを使って のビームサイズ調整となった. IP-BSM でのビームサ イズ調整には、Multi-knob の $\eta_y$ ,  $\alpha_y$  knob と、Coupling 補正の knob には、最初の1回目は最終収束電磁石の Roll を使い、2回目以降は Multi-knob の <x' y>knob を使った. IP-BSM は、ビームサイズの測定範囲が 300~1000 nm に対応するレーザー交差角 8° (3.8  $\mu$ m ピッチ) に設定された.

IP-BPM を使って、 $\eta_y$ ,  $\alpha_y$ , Coupling の最適化を3 回繰り返した. 続いて、個々の6極電磁石の Mover

表2 ATF2 仮想衝突点のパラメータ

効果	調整	SF6FF	SF5FF	SD4FF	SF1FF	SD0FF
$\alpha_x$	$  \Delta_x $	700	0	0	-185	-300
$\alpha_y$	$  \Delta_x $	0	400	0	-160	-300
$\eta_x$	$  \Delta_x $	95	-175	0	100	-25
$\eta_y$	$ aigsim_y$	-60	0	-300	-230	300
$\langle x'y \rangle$	$\Delta_y$	0	0	0	0	60



**図 19** 連続運転において最小のビームサイズを記録したとき の IP-BSM modulation 信号



図20 偏極γ線レーザー装置の開発. 左が 2-mirror, 右が 4-mirror optical cavity system

の水平方向位置をずらして,ビームサイズを測定した ところ,ビームサイズは,それぞれの6極電磁石の位 置に対して最小値となっていることを確認した.結果 は,図19のように,レーザー交差角8°においてモジュ レーションが0.87だった.この値から,ビームサイ ズは310 +/-30 (stat.)+0-/40 (syst.) nm と評価され る<sup>24)</sup>.

#### 5.3 ATF2 連続調整運転の考察

今回の連続調整運転では、仮想衝突点における垂直 ビームサイズを 310 nm まで絞り込むことができた. しかしながら,設計光学系から期待されるビームサイ ズ 114 nm と比較して約 3 倍大きな値であった. この 原因として、仮想衝突点でのベータ関数のミスマッチ が疑われる.しかし、この影響は大きく無いと考えて いる.初期調整の際に直下流(40cm)の Wire Scanner でビームサイズを測定し、水平方向は 100 µm、垂直 方向は 50 µm と期待される値が得られていたためであ る.

Chromaticity や Geometrical Aberration の補正が十 分でなかった可能性もある. これらの影響が大きく効 いてくるのは 200 nm 以下のビームサイズに対してで あり,今回の到達ビームサイズ 310 nm では影響は大 きく無いとも思われる. しかし,6極電磁石の最適化 は行っていないので,今後の課題として残る.

仮想衝突点におけるビーム位置のジッターを調べる 必要がある.そのために高分解能 IP-BPM を開発試験 しているが,まだ仮想衝突点(近傍)へは設置されて いない.次回のビーム調整運転までに,試作機を衝突 点近傍に設置する予定である.

今回の連続運転において、最小の垂直ビームサイズ を実現するためには、最終収束電磁石 QF1FF と QD0FF の Roll 差を5.7 mrad と非常に大きく設定しな ければならなかった. この Roll の差は、仮想衝突点で の Coupling に大きく影響を与える.一方で、最終収束 ビームラインに入る前の Coupling は小さく測定されて いる.上流の電磁石で作られた Coupling を補正するた めに,最終収束電磁石を大きく回転させる必要があっ た訳では無いと考えられる.それ故,最終収束電磁石 QF1FF と QD0FF の間で不自然に大きい Roll の差が生 じていると考えるのが自然である.また,電磁石のア ライメントは,基準に対して mrad 以下の精度で行わ れており,このような大きな Roll 差は,電磁石に何か 不具合がある可能性も示唆している.QF1FF の高次 の磁場成分は,仮想衝突点のビームサイズに最も敏感 なので,次回の運転までに詳しい調査を進める事とし た.

最後に、今回の連続運転における仮想衝突点での垂 直ビームサイズ測定では、IP-BSM へのレーザービー ム転送系のドリフトなどの影響で、定期的に IP-BSM システムの調整を行わなければならなかった。特に、 最終日は気温が高く1日の温度変化が激しかったの で、この影響は非常に大きかった。レーザー転送系に フィードバックを導入し、長期間にわたり安定な測定 ができるように改良を加える。

# 6. その他

ATF ではレーザーと電子ビームの逆 Compton 散乱 による偏極  $\gamma$  線を利用する偏極陽電子源の開発研究も 進められている. パルスレーザーと電子ビームの衝突 による原理実証実験<sup>33)</sup>を経て, 2-mirror optical cavity による高輝度のレーザー蓄積装置の開発がダンピング リング内で進められてきた<sup>34)</sup>. 今後は, optical cavity としての制御 tolerance が大きく, 安定化が期待され る 4-mirror system の開発を行う<sup>35)</sup>.

# 7. 最後に

現在, ATF/ATF2 で進行している多くの開発研究は, ILC 実現の鍵となる技術の確立を目指すものである. ILC 加速器の国際共同設計チーム(GDE)は、2012年 に技術設計報告書(TDR)をまとめる予定であり、 ATF/ATF2での開発研究は、この TDR の技術的裏付 けに大きく貢献すると期待されている。我々はそれに 答えるべく、主要な技術について以下のような時期に 達成することを目標とし開発研究を進めている。

1) 2 pm の低エミッタンスの実現: 2012 年度

- 2) ナノ秒高速キッカーの実証試験:2011 年度
- 3) 垂直 37 nm の極小ビームの実現: 2010 年度
- 4) ナノメートルビーム位置安定化: 2012 年度

また、本文では触れなかったが、米国で製造試験が 進められている超伝導最終収束電磁石を ATF2 のビー ムで評価試験する提案などもあり、次のステップに向 けた検討も進められている.

以上のように、ATF/ATF2 での研究課題は多彩であ り挑戦的である. 国内外から多くの研究者が参加して おり、彼らとの国際的な共同研究体制の下で、TDR をまとめる 2012 年を一つの区切りとして目標の達成 を目指している. 大学院生を含め多くの若手研究者が 活発に活躍しており、今までに数多くの学位取得者(博 士および修士)が国内外で誕生している. 若手研究者 の育成も ATF の重要な役割である.

以上,先端加速器試験装置(ATF/ATF2)の現状に ついて概要を報告しました.開発項目が多く,十分な 説明が出来ていないところもあることをお詫びいたし ます.詳細については参考文献をご参照頂ければ幸い です.

## 謝辞

ATF の国際的な研究活動を推進するにあたり,日頃 より御指導・御支援頂いております高エネルギー加速 器研究機構の鈴木機構長,高崎理事,神谷理事,生出 加速器施設長および LC 推進室に深く感謝申し上げま す.また,今回の報告をする機会を与えて頂きました 加速器学会誌編集委員の方々に感謝致します.

# 参考文献

- 1) F. Hinode et al., KEK Internal 95-4.
- 2) ILC RDR, ILC-REPORT-2007-001.
- 3) ATF2 Proposal, Volume 1, KEK Report 2005-2, Volume 2, KEK Report 2005-9.
- P. Bambade et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams, 13, 042801 (2010).
- 5) J. Urakawa, Proceedings of PAC07, Albuquerque, New

Mexico, USA, 2007, p.1950.

- 6) Y. Honda, Proceedings of APAC07, Indore, India, 2007, p.308.
- 7) The ATF international collaboration, http://atf.kek.jp
- N. Terunuma et al., Nucl. Instr. and Meth. A613, 1 (2010).
- 9) T. Imai et al., KEK- Preprint 2002-16, May 2002.
- T. Naito et al., Nucl. Instr. and Meth. A571, p.599 (2007).
- 11) 内藤孝ほか, 第7回加速器学会, WEPS003 (2010).
- 12) P. Burrows et al., Proceedings of IPAC10, Kyoto, Japan, 2010, MOPE074 and WEPEB044.
- 13) S. Walston et al., Nucl. Instr. and Meth. A578 (2007) 1-22.
- 14) Y. Inoue et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams, **11**, 062801 (2008).
- P. Priet et al., Presented at 13th Beam Instrumentation Workshop (BIW08), Lake Tahoe, California, May 2008.
- T. Naito et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams, 9, 122802 (2006).
- 17) H. Sakai et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams, 10, 042801 (2007).
- Y. Honda et al., Nucl. Instr. and Meth. A538 (2005) p.100.
- H. Hayano, Proceedings of Int. Linac Conf., Monterey (2000) p146.
- 20) J. Alabau-Gonzalvo et al., Proceedings of IPAC10, Kyoto, Japan, 2010, MOPE050.
- 21) L. Deacon, Thesis (PhD), University of London (Royal Holloway), 2009.
- 22) T. Shintake, Nucl. Instr. and Meth. A311 455 (1992).
- T. Suehara et al., Nucl. Instr. and Meth. A616, 1 (2010).
- 24) Y. Kamiya et al., Proceedings of IPAC10, Kyoto, Japan, 2010, MOPE022.
- K. Kubo, Phys. Rev. ST Accel. Beams, 6, 092801 (2003).
- 26) ATF Collaboration, Phys. Rev. Lett. 88:194801, 2002.
- 27) Y. Honda et al., Phys. Rev. Lett. 92:054802, 2004.
- 28) K. Kubo et al., Proceedings of PAC09, Vancouver, Canada (2009) ; FR1RAC05.
- 29) J. Safranek, Nucl. Instr. and Meth. A388 (1997) 27-36.
- 30) A. Wolski et al., EPAC 2004, Paper ID MOPLT142.
- 31) M. Woodley, 3rd ATF2 project meeting (2007).
- 32) N. Walker et al., SLAC-PUB-6207 (1993).
- 33) T. Omori et al., Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 114801.
- 34) S. Miyoshi et al., Nucl. Instr. and Meth. A. DOI:10.1016/j.nima.2010.03.075.
- 35) J. Bonis et al., 第7回加速器学会, THPS104 (2010).